19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 190794

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)8月8日

C 30 B 15/00 27/02 8518-4G 8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全3頁)

図発明の名称 単結晶製造方法およびその装置

②特 願 昭62-23373

②出 願 昭62(1987)2月2日

⑫発 明 者 中 川 正 広 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

⑫発 明 者 多 田 紘 二 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

⑫発 明 者 龍 見 雅 美 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

⑪出 願 人 住友電気工業株式会社

划代 理 人 弁理士 青木 秀實

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

明 和 4

1. 発明の名称

単結晶製造方法およびその装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) チョクラルスキー法による単結品製造において、引上げ軸と同心に、軸に取り付けた羽根を用い、単結品引上げを行う前段階で、原料融被表面、もしくわ液体封止剤の中に混在しているスカムをるつぼの壁付近に追いやり、るつぼの中心部のひろい範囲にわたってスカムをなくしてから成長を行うことを特徴とする単結品製造方法。
- (A) チョクラルスキー法による単結品製造後費において引上げ軸と同心に、上下することができる軸により羽根を取り付けたことを特徴とする単結
 の製造装置。
- (3) 羽根が PBN 製である特許請求の範囲第2項記 級の単結晶製造装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野].

本売明は、 GaAs , InP , S i 等の単結晶の製造

方法およびそのための製造設置に関するものであ -

[從来技術]

従来のチョクラルスキー法(CZ 法)、あるいは被体封止チョクラルスキー法(LEC 法)による単結晶の製造は、はじめ原料多結晶と必要であれば被体封止剤をるつぼに入れ、これを溶験したのち、引上げ軸に取り付けた種結晶を融液に浸し、引上げ軸とるつぼをゆっくり回転し、ゆっくりと引上げながら結晶成長を行っている。

結晶となる物質が化合物である場合には、るつば内で合成し、それを原料とする場合もある。

[発明が解決しようとする問題点]

上述の従来の方法では、原料多結晶に酸化物の不純物があると、それが遊離し、原料酸液の表面あるいは液体封止剤中に浮き、成長中の結晶にまつわりついて、単結品化が防げられることが多かった。

[発明の構成]

本発明は、上記問題の解決のために、原料融液

を満たし、回転しているるつぼの中に、るつば、引上軸と同心配配の放射状の羽根を入れ、浮いているスカム(scum)をるつぼの壁近くまで追いやった後、羽根を上昇し、その後種付けを行って成長を開始するものである。

第1図は本発明装置の機略を示す。7はるつぼであり、8はるつぼ7を保持し、回転できる下軸である。4は回転し、上下できる引上げ軸であり、1は引上げ軸4、るつぼ7と同心に配置された羽根であり、2図には第1図羽根1の一例を上面図で示す。第1図において、8は原料酸液を示し、9は被針止剤を示し、5はスカムを示し、9は被針止剤を示し、5はスカムを視結晶を示し、10元の発達である。10元のである。10元のでは10元のである。10元のでは10元のである。10元のでは10元のである。10元のでは10元のである。10元のでは10元のである。10元のでは10元のである。10元のでは10元のである。10元のでは10元

第2図の、何、何、何、日は本免明による作業手順を示している。 の図に示すようにるつぼ7を回転した状態で加熱し、原料は融被8となり、その上

は、スカムのためと思われる多結晶化が4回起こり、単結晶化率は80%であった。本発明を採用した20回の結晶成長について、以下に起す。羽根の外径148mm内径40mmのPBN製のものを用い、原料散解後に、GaAs メルトの上1 mmのところにこれを降ろし、るつぼを35r.p.mで回転させた。これによりスカムが周囲においやられ、PBN るつぼの内面に付替した。その後種付けを行ったところ、20回の結晶で18回単結晶が成長し、単結晶化率は30%に創上した。

[発明]的效果]

以上説明のように、木発明方法によれば、単結品の製造において、原料酸液又は封止剤に混在するスカムをるつぼの壁付近に追いやって、スカムによる単結晶成長の紡げを抑止しすることができる。

又、引上げ勧、るつぼと同心に、勧によって昇降できる羽根を取付けることによって、スカムをるつば壁付近に追いやることができ、この作業の終了後、引上げて直ちに種付け、単結品成長に入

を被体封止相当で取う。何図に示すように、羽根1を柏2によって下降させ、被体封止削3の中に 役す。被体封止削3中にあるスカム5はるつば7の回転により、何図に示すように、羽根1に沿い 次郊にるつぼ7の壁に近い方に移され、結果的に るつぼ7の中心部のひろい 範囲にわたりスカム5 がなくなる。その後 (日図に示すように、羽根1を 軸2によって引上げ、引上げ 軸4を下降させ、 極端3を原料融液 6へ没して結晶引上げを明光する。 記録は結晶を示す。

被体對止剤を用い、又は用いない場合、原料融被 8の表面に羽根 1を浸して同様に作業する。この場合、羽根 1を保持する軸 2の上下位置を調整して繰返すことができる。羽根 1の材質としてはPBN が厳調である。

fit in (4)

内径 150 mm の PBN るつばに GaAs 多結晶 3 kg 、 B₂O₃ 500 g を入れて加無融解し、単結品の育成を 試みた。

本発明を採用しないで行った20回の結晶成長で

ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の設置の機略図である。第2 図は、第1図装置の羽根の一例を示す。第3図(1)、(1)、(1)、(1)は、本発明の手順説明図である。

1 … 羽根、 2 … 軸、 3 … 種結晶、 4 … 引上げ軸、 5 … スカム、 6 … 原料融液、 7 … るつぼ、 8 … 下 軸、 9 … 液体對止剂、 10 … 結晶。

代理人 弁理士 資本秀質

特開昭63-190794(3)

